

中国科学院上海微系统与信息技术研究所文件

科沪微所字〔2026〕141 号

中国科学院上海微系统与信息技术研究所关于 印发《中国科学院上海微系统所公共技术 中心超导电子器件与电路研发平台 收费标准》的通知

机关各部门、各实验室：

《中国科学院上海微系统与信息技术研究所公共技术中心超导电子器件与电路研发平台收费标准》已经 2026 年 8 月 31 日所务会讨论通过，现印发给你们，自印发之日起施行。

中国科学院上海微系统与信息技术研究所

2026 年 9 月 3 日

中国科学院上海微系统与信息技术研究所公共技术中心

超导电子器件与电路研发平台收费标准

类别	设备名称	规格型号	项目	机时费		代工费	耗材费	备注
				所内	所外			
薄膜生长	超高真空磁控溅射系统	LESKER CMS18	磁控镀膜	400 元/30 分钟	500 元/30 分钟	150 元/30 分钟	Au 10 元/nm; Nb、Ti、Mo: 1 元/nm。	4 英寸靶材
	超高真空磁控溅射系统	北京世华尖峰 AFS1500UH V	磁控镀膜	400 元/30 分钟	500 元/30 分钟	150 元/30 分钟	Ta: 10 元/nm	8 英寸靶材
	高真空磁控溅射仪	Canon ANELVA EB1100	磁控镀膜	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟	150 元/30 分钟	Pd: 10 元/nm; Mo、Ti: 1 元/nm。	4 英寸靶材
	液态源化学气相沉积系统	SAMCO PD-270STLC	介质镀膜	1000 元/30 分钟	1250 元/30 分钟	250 元/30 分钟	10 元 /100nm (100nm 为最小计量单元)。	TEOS 液态源
	液态源化学气相沉积系统	Sentech SI500D	介质镀膜	1000 元/30 分钟	1250 元/30 分钟	250 元/30 分钟		
	多腔体磁控溅射系统	ULVAC SME-200J	磁控镀膜	1000 元/30 分钟	1250 元/30 分钟	250 元/30 分钟	Nb 、 NbN 、 NbTiN 、 Al 、 Mo: 10 元/nm。	8 英寸靶材
	高真空复合蒸发系统	ULVAC EI5	电子束和热蒸发镀膜	600 元/30 分钟	750 元/30 分钟	150 元/30 分钟	Au: 40 元/nm; 其他: 2 元/nm。	
	超高真空超导薄	ULVAC	磁控镀膜	600 元/30 分钟	750 元/30 分钟	150 元/30 分钟	Au、Pt、Pd:	4 英寸靶材

	膜镀膜系统	MPS6000					10 元/nm；其他：1 元/nm。	
微纳加工	超高精度电子束曝光系统	ELIONIX ELS-F125G	EBL	1200 元/30 分钟	1500 元/30 分钟	400 元/30 分钟	PMMA 、ARP6200：50 元/片；ZEP、HSQ：200 元/ml。	
	电子束曝光系统	JEOL JBX-6300FS	EBL	1200 元/30 分钟	1500 元/30 分钟	400 元/30 分钟	PMMA 、ARP6200：50 元/片；ZEP、HSQ：200 元/ml。	
	激光直写曝光机	HEIDELBERG DWL66+	激光直写	600 元/30 分钟	750 元/30 分钟	250 元/30 分钟	胶 50 元/片	
	DUV 步进投影光刻机	Canon FPA-3030EX 6	投影曝光	4000 元/片	5000 元/片	400 元/30 分钟	掩模版自备	机时费实行同一批次批量作业阶梯计费规则,该类作业为同一批次使用同一 job 完成多片重复曝光（1-5 片原价，6-25 片超出 7 折，26 片起超出 3 折）；量产级服务价格另议。
	i-line 步进投影光刻机	Canon FPA-3030i5+	投影曝光	2000 元/片	2500 元/片	400 元/30 分钟		
	全自动匀胶显影	TELECT8	匀胶、显影	800 元/30 分钟	1000 元/30 分钟	400 元/30 分钟	胶 100 元/片	限设备自带光刻

系统								胶和显影液
光刻胶处理系统	SUSS Delta80RC	匀胶、显影	200 元/30 分钟	250 元/30 分钟	150 元/30 分钟	胶 50 元/片	用户	提供光刻胶时不计耗材费。
自动匀胶显影机	台湾帆宣 MJCD4C2RS H001	匀胶、显影	300 元/30 分钟	400 元/30 分钟	150 元/30 分钟	胶 50 元/片	限设备	自带光刻胶和显影液
自动匀胶显影机	Obducat MC204	匀胶、显影	300 元/30 分钟	400 元/30 分钟	150 元/30 分钟	胶 50 元/片	限设备	自带光刻胶和显影液
接触式紫外光刻机	SUSS MA6	光刻	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟	150 元/30 分钟	掩模版自备		
反应离子刻蚀机	Oxford PlasmaPro 80 RIE	RIE	350 元/30 分钟	450 元/30 分钟	150 元/30 分钟			带激光刻蚀终点监测
反应离子刻蚀机	SAMCO RIE 10-NR	RIE	300 元/30 分钟	400 元/30 分钟	150 元/30 分钟			
感应耦合等离子体刻蚀机	Oxford PlasmaPro100 -Cobra	ICP	450 元/30 分钟	600 元/30 分钟	150 元/30 分钟			带光谱 OES/激光刻蚀终点监测
氧化膜等离子体刻蚀机	SAMCO RIE-800iP	ICP	450 元/30 分钟	600 元/30 分钟	150 元/30 分钟			带光谱 OES/激光刻蚀终点监测
深硅 ICP 刻蚀机	Oxford PlasmaPro100 Estrelas	深硅刻蚀	800 元/30 分钟	1000 元/30 分钟	150 元/30 分钟			
离子束刻蚀机	Oxford Ionfab300	离子束刻蚀	500 元/30 分钟	750 元/30 分钟	150 元/30 分钟			
高精度复合刻蚀系统	鲁汶 LMEC-200	离子束刻蚀+介质层刻蚀	1000 元/30 分钟	1250 元/30 分钟	150 元/30 分钟			
HF 蒸汽刻蚀机	SPTS uEtch	氧化硅气	1000 元/30 分钟	1250 元/30 分钟	250 元/30 分钟			

			相腐蚀					
	离子束切割仪	JEOL IB-19530 CP	截面样品 制备	100 元/30 分钟	125 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	紫外臭氧去胶机	SAMCO UV-1	去胶	100 元/30 分钟	125 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	去胶机	SAMCO PC-1000W	等 离 子 体 灰化	100 元/30 分钟	125 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	晶圆清洗系统	无 锡 华 瑛 HY-SW	HF 晶圆清 洗	125 元/30 分钟	150 元/30 分钟	250 元/30 分钟		
	有机清洗系统	TAKADA Twsa-6000A	有机清洗	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	掩模版清洗机	雷 博 MS200-MS	光刻版清 洗	150 元/30 分钟	200 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	化学机械抛光机	GnP POLI-400L	CMP	250 元/30 分钟	325 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	化学机械抛光机	REVASUM 6EC-II	CMP	325 元/30 分钟	400 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	CMP 后清洗	Entrepix DSS-200	CMP 抛光 后清洗	250 元/30 分钟	325 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	化学机械抛光机	东 京 精 密 ChaMP211	干进干出 CMP	600 元/30 分钟	750 元/30 分钟	250 元/30 分钟		
分析表征	热场发射扫描电 子显微镜	ZEISS Gemini300	SEM 形貌 观察	200 元/30 分钟	250 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
			EDS 元素 分析(牛津 UltimMax1 00)	点线扫描: 40 元/ 点线; 面扫描: 120 元/30 分钟	点线扫描: 60 元/ 点线; 面扫描: 150 元/30 分钟	/		EDS 费用不含 SEM 机时费, 需 在 SEM 使用费基 础上叠加计收。

	镀膜仪	LEICA ACE600	金属、碳导电薄层	50 元/30 分钟	75 元/30 分钟	150 元/30 分钟	Au, Pt: 10 元/nm; 其他: 1 元/nm。	
	高分辨 X 射线衍射仪	Bruker D8 discover	常规 XRD	200 元/30 分钟	250 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
			变温 XRD	325 元/30 分钟	400 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	原子力显微镜	AR Jupiter XR	AFM	200 元/30 分钟	250 元/30 分钟	150 元/30 分钟	探针自备或平台提供（按不同探针规格市场价另计）	
		Bruker Dimension Icon	PFM/MFM /EFM/CF M/KPFM/ STM 等	300 元/30 分钟	375 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	光谱椭偏仪	HORIBA Uvisel Plus SENTECH SE800 DUV	膜厚、光学常数表征	100 元/30 分钟	125 元/30 分钟	150 元/30 分钟		含简易模型常规拟合; 复杂样品建模分析人工费另计(该费用不计设备机时)。
	台阶仪	KLA P-17 KLA P16+ Bruker DektakXT	膜厚、表面形貌、应力测试	50 元/30 分钟	75 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	激光显微镜	Keyence VK -X210 Olympus OLS4100	表面形貌观察	75 元/30 分钟	100 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	表面颗粒分析仪	KLA Candela CS10	表面颗粒	200 元/30 分钟	250 元/30 分钟	150 元/30 分钟		适用于硅晶圆裸片
	图形片缺陷检测	KLA 2138XP	图形片上	250 元/30 分钟	350 元/30 分钟	150 元/30 分钟		适用于图形片

	系统	中电光导 NanoPro-150	各类缺陷 检测					
	薄膜应力测试仪	FSM 128NT	薄膜应力	50 元/30 分钟	75 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	自动光学膜厚仪	KLA F54-XY-200- UV	薄膜厚度	75 元/30 分钟	100 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	综合物性测量系 统	QD PPMS Dynacool	材料磁学、 电学等物 性测量	250 元/30 分钟	325 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	磁学测量系统	QD MPMS3	材料磁学 性能测量	250 元/30 分钟	325 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	关键尺寸扫描电 镜	Hitachi S-8820	CD-SEM	600 元/30 分钟	750 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
封装	划片机	DAD3221	晶圆切割	100 元/30 分钟	125 元/30 分钟	150 元/30 分钟	刀片自备或平 台提供（按不 同刀片规格市 场价另计）	
	高精度倒装焊机	SET-FC150	倒装焊接	500 元/30 分钟	600 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	手动引线键合机	TPT HB10 Westbond747 6E	引线键合	25 元/30 分钟	50 元/30 分钟	150 元/30 分钟	Al 线免费；金 线 10 元/cm。	

收费说明：

1. 机时费和代工费按照 30 分钟为基本时间单元计算；
2. 原则上收费标准每两年更新一次；
3. 贵金属定价每年更新一次；

4. 服务方式：送样加工/测试；
5. 本表中费用针对标准服务时限；若需加急服务，按 1.5 倍结算；若需特急服务，按 2 倍结算；标准、加急和特急服务时限由双方另行约定。
6. 平台如有新增设备，收费标准参考同型号设备。
7. 以上报价均未包含税费和管理费；外单位委托进行工艺、器件开发的，平台根据具体内容与要求评估后报价。

